

# スクリーン ミニレポ

本誌は、当社の最新ニュースと事業活動をお知らせする情報誌です。

## 目次

- ・セミコン・ジャパン 99  
半導体業界の好調を反映
- ・次世代の半導体プロセスに対応した最新鋭洗浄装置を開発
- ・Low-k膜に対応したSODコータ「SC-W80A-AVD」を開発
- ・台南で半導体・液晶製造装置のサービスセンターを開設
- ・全国縦断セミナーとプライベートショーを開催

## セミコン・ジャパン 99 半導体業界の好調を反映

当社は、12月1日～3日、千葉・幕張メッセで開催された展示会「セミコン・ジャパン99」に出展しました。同展示会は、半導体材料、製造装置の国内最大の総合展示会。日本経済の牽引役として成長を期待されている半導体業界だけに、各調査機関や金融証券業界などの関心も高く、3日間で約12万人が訪れました。当社は、「微細化に対応した洗浄技術」、「コストパフォーマンス」、「地球環境」をキーワードに数々の新製品を紹介。当社ブースは例年以上の賑わいで、中でも8

インチウエハー用スピンプロセッサ「MP-2000」に注目が集まりました。

セミコン期間中に、当社講師によるお客様向けの先端技術セミナーやライカ社との合同技術セミナーを開催。展示会より一歩踏み込んだ内容で当社の技術や製品を説明しました。



製品紹介のビデオ上映に見入る来場者

次世代の半導体プロセスに対応した最新鋭洗浄装置を開発（11月27日付け発表）

当社は、微細化に対応した半導体製造に使用する、次世代洗浄装置3機種を12月1日から販売しました。今回発売する装置は、単一の処理チャンパー内で半導体の洗浄プロセス処理が可能になったスピンプロセッサ「MP-2000」、半導体回路を形成するドライエッチング\*工程でウエハーに生成される不要物（ポリマー）を除去するポリマー除去装置「SD-W80A-AW」、300ミリのウエハーを均一に洗浄できるスピンスクラバー「SS-3000」。半導体製造プロセスにおける微細化に伴いウエハー上のパーティクル（ゴミ）除去処理が以前にも増してクローズアップされている中、当社の強みである洗浄技術を活用、同時に生産性とC.O.O.（\*Cost of Ownership）を向上させています。

「セミコン・ジャパン」で注目を集めた「MP-2000」は、デザインルール0.13ミクロン以下の微細化に対応、また装置のコンパクト化によりクリーンルームの効

率化を実現した新開発の枚葉式洗浄装置。複数の薬液処理からリンス・乾燥を1つの密閉処理室で行える「ワンチャンパー処理方式」の開発で、ウエハー周囲の空気（雰囲気）による汚染を低減するなど高精度洗浄処理を可能にしました。さらに、薬液供給・回収システムの新採用と吐出条件の最適化で、薬液・純水の消費量を削減しています。

\*ドライエッチング：ウエハー上にフォトリソグラフィ技術を使って写し込まれたパターンを減圧下の活性ガスプラズマで削り落とし、半導体の回路を形成する方式。

\*Cost of Ownership：半導体製造装置に関する設備投資や運営の経済性の評価基準を経営レベルでモデル化したもの。



枚葉式洗浄装置「MP-2000」  
価格1.2～1.5億円（仕様により異なる）  
初年度販売予定台数50台



枚葉式ポリマー除去装置「SD-W80A-AW」  
価格1.2～1.8億円（仕様により異なる）  
初年度販売予定台数20台



スピンスクラバー「SS-3000」  
価格7,000万～1.2億円（仕様により異なる）  
初年度販売予定台数20台

Low-k膜に対応したSODコータ「SC-W80A-AVD」を開発(11月27日付け発表)

当社は、情報通信機器などに使用されるデバイスの微細化が進む中、半導体の多層化技術として注目されるLow-k膜に対応したSODコータ「SC-W80A-AVD」を開発、12月1日から販売しました。Low-kとは、低誘電率化を可能とする層間絶縁膜の塗布材料。半導体回路の微細化が求められる中、配線や絶縁膜の細小化への対応策として、アルミ配線、SiO<sub>2</sub>膜の組み合わせに代わり、Cu(銅)配線とLow-k絶縁膜の利用が進みつつあります。このマーケットニーズを敏感にとらえたSODコータ「SC-W80A-AVD」は、ウェハーを回転させながらLow-k材料を塗布する「Spin-On-Coat方式」を採用。各塗布材料に対応した専用ユニットを搭載

し、多種多様なLow-k材料に適応します。標準価格は、1.2~1.8億円(仕様により異なる)



初年度販売予定台数は50台

台南で半導体・液晶製造装置のサービスセンターを開設(10月28日付け発表)

当社は、台湾・台南県に半導体・液晶製造装置のサービスセンターを開設、1999年10月27日にオープンしました。このセンターは、大日本スクリーン・台湾(Dainippon Screen (Taiwan) Co., Ltd.)が新設する台南の拠点で、昨年11月に新竹(シンチュウ)市科学園区隣接地に開設したテクニカルセンターに続き、台湾市場における半導体・液晶製造装置の技術サービスをさらに強化するもの。センターには、サービス技術者数名が常

駐し、台南科学園区のユーザーに24時間体制のサービスを提供します。なお、当社は、このサービス強化により半導体・液晶製造装置の年間約30~40億円の売上増を見込んでいます。

\* Dainippon Screen (Taiwan) Co., Ltd.

1990年に大日本スクリーンの子会社として設立。資本金は2億1,500万NTドル、従業員数71人(99/9末)。設立当初は、印刷・製版産業向け画像処理システムの販売・保守サービスのみを業務。1995年から当社の半導体製造装置のサービスを手掛け、さらに1998年から液晶製造装置の販売およびサービスも行っている。



by MIXA IMAGE LIBRARY

全国縦断セミナーとプライベートショーを開催

当社は、11月4日~25日、鹿児島から札幌までの主要都市16カ所で、「デジタル・新次元」をコンセプトに、グラフィックアーツ総合展示会「IGAS99」での製品動向と2000年に向けてのCTPワークフローを説明する全国縦断セミナーを開催しました。

うち、東京・大阪・名古屋支店では、毎年好評を博しているプライベートショーを開催し、CTPやデジタルプレス、ネッ

トワークをはじめとする新製品の紹介やデモを実施。この縦断セミナーには約3,000名のお客様が参加されました。



東京支店でのセミナーは連日満員

スクリーンミニレポ No. 213  
1999年12月20日発行

大日本スクリーン製造株式会社

〒602-8585  
京都市上京区堀川通り寺之内上ル4丁目  
Tel 075-414-7131  
Fax 075-431-6500  
発行人：広報室 齋藤牧夫

